

## 顧問挨拶



特許技監 木原 美武

只今、ご紹介いただきました特許技監の木原です。特許庁技術懇話会の顧問といたしまして、一言、挨拶を申し上げます。

本日の特技懇懇親会には、先程ご挨拶をいただきました伊藤特許庁長官、設楽知的財産高等裁判所所長を初め、多くのご来賓の皆様にも、大変ご多忙の中、また非常にお暑期中、ご出席をいただきました。誠に有り難うございます。本日は、本年7月に新たに審査官補として採用されました任期付職員73名も含めまして114名の新人も出席しております。限られた時間ではありますが、彼らを含めまして特技懇メンバーと、是非、懇親を深めていただき、今後も、より一層のご支援、ご指導を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

さて、本日は、折角の機会でございますので、私共を取り巻く状況について、いくつかお話をさせていただきたいと思っております。

まず、特許の審査についてであります。小泉内閣における2002年の知財立国宣言等を受け、この10年、私共は、特許審査の迅速化・効率化を最大の課題として捉え、2013年度末までに、審査請求からファーストアクションまでの期間、すなわちFA期間を11月にするという長期目標（FA11目標）に向かって、日々、努力して参りました。その結果、一時は、審査待ち件数が90万件を超え、FA期間が30月に迫るといった時期もございましたが、常にその目標達成に向けて邁進し、遂に本年3月、その目標を達成することが出来ました。もちろん、これには審査官各位の弛まぬ努力があったわけですが、それと共に、この大目標の達成は、IPCC等登録調査機関を初めとする関係団体の皆

さまや、制度ユーザーの皆さまに、特許審査に係る各種取組への御理解、御協力をいただいたことの賜物であります。この場をお借りして、高いところからではございますが、改めまして厚く御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

ただ、当然のことながら、FA11目標を達成したことが、私たちの最終ゴールではありません。この10年で特許制度を取り巻く環境は大きく変わりました。研究開発や企業活動のグローバル化が進展し、更なるイノベーションと企業収益の増進を図るため、大企業のみならず中小企業等にとっても、海外を含む知的財産戦略の重要性が一層増しております。特に中国、ASEAN諸国、インド、ブラジルといった新興国への戦略が益々重要になってきており、それらの新興国も含め、如何にグローバルイノベーションサイクルを回していくのかが、日本経済再興の鍵となっております。

このような情勢の下、本年6月24日に閣議決定されました「日本再興戦略」改訂2014でも謳われております、世界最高の知財立国の構築を目指し、今後10年の内に、「世界最速・最高品質の審査」を実現すべく、私共は、全力で取り組んで参る所存です。

具体的には、まず、「世界最速」という点につきましては、特許審査におけます審査請求から権利化までの期間を半減し、世界最高水準の14か月以内に短縮することを目標にいたしました。次に、「世界最高品質」という点につきましては、我が国の審査結果が国際的に信頼され、我が国で特許になれば海外特許庁においても特許となる予見性が高まるような「世界で通用する安定した特許権」、すなわち「強く・広く・役に立つ特許権」を設定していくということを目指と致しました。そのため、まず、その基本原則となる「特許審査に関する品質ポリシー」を本年3月に策定し、公表致しました。今後は、これに基づいて、外国文献を含め先行技術調査のより一層の充実化、品質管理官をはじめとする品質管理体制の強化等、質の向上に向けた取組を一層充実させて参ります。また、実務者や学識経験者の参画を得て、品質管理の実施状況や実施体制を客観的に評価いただく委員会を、今、正に設置しようとしているところでありまして、そこでの評価を内部の取組に反映することで、「世界最高品質の審査」の実現につなげてまいります。加えて、まず米国との関係において、米国が受理したPCT出願の国際調査・国際予備審査を我が国が行えるよう、我が国の管轄権を米国に拡大する試行、及び日米の特許審査官が協働して審査を実施する試行を、来年4月にもスタートさせることに、本年6月、日米間で合意しました。我が国の審査が世界最高品質となるための一つのステップとして、この試行に取り組んで参る所存であります。

また、国際面での取組としては、国際展開を進める日本



企業の諸外国における知的財産戦略をより一層支援することが急務となっております。そのため、まず特許制度及びその実務運用のハーモナイゼーションは必須であるという認識の下、例えば、先進国特許庁によるテゲルンゼー会合での制度調和に向けた取組を受け、先週の7月10日、本日のこの会場で、グレースピリオド等の国際調和を目指したシンポジウムを、我が国特許庁が率先して開催し、世界各国・各地域の特許庁や制度ユーザーから約400名の参加を得て、制度調和に向けた機運を、より一層高めたわけであります。また、日米欧中韓の五大特許庁の枠組みでも、先月、韓国釜山で開催されました長官会合において、制度ユーザーの皆さんが最も優先して調和を望んでいる、単一性、記載要件、先行技術開示義務の三項目について、ハーモナイズすべく検討を進めることに合意致しました。このように、制度運用調和に向けた取組は、今が正に正念場であり、私共は、2006年に日米特許審査ハイウェイを開始するなど、世界をリードしてきた特許庁であることを自負し、制度・運用調和という、この長年の大課題を必ず解決するのだという強い気概と熱意を持って取り組んで参ります。

以上、時間の関係もあり、特許審査及び国際調和を中

心としたお話となりましたが、もちろんこれ以外にも多くの取り組むべき課題がございます。例えば、この春の通常国会で審議され、可決・成立しました、改正法への対応として、本日の特技懇メンバーにとっては、特に、特許におけます付与後異議制度の導入、また、意匠におけますジュネーブ改正協定への加入、すなわち国際意匠出願の受付について、しっかりとその施行が出来るよう、万端の準備が必要です。また、今後の制度見直し課題として、日本再興戦略等にも掲げられております、職務発明制度の改善や営業秘密保護対策にもしっかりと取り組まなければなりません。さらに、特許庁業務・システム最適化計画を含む情報システム関連施策の推進、また、中小企業、大学、個人、地方に対する施策の推進等にもより一層の注力が必要です。

そのようにまだまだ多くの課題がございますが、特技懇メンバー一丸となって、「世界最速かつ最高品質の知財システム」を実現し、世界最高の知財立国としての地位を不動のもとして確立していくべく、頑張っ参りたいと思っております。最後に、本日まで参加いただきました皆様の益々のご健勝とご発展を祈念しまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

